PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-019314 (43)Date of publication of application : 23.01.2002

(51)Int.Cl. B41N 1/14 B41C 1/055 G03F 7/004 G03F 7/032

GO3F 7/032 GO3F 7/033 GO3F 7/038 GO3F 7/09

(21)Application number: 2000–202667 (71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing: 04.07.2000 (72)Inventor: HOSHI SATOSHI

MAEMOTO KAZUO HOTTA HISASHI

(54) THERMOSENSITIVE LITHOGRAPHIC PRINTING ORIGINAL PLATE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a thermosensitive lithographic printing original plate capable of printing by mounting directly in a printer without treating after exposure and having excellent plate wear resistance, being hard to stain and improving sensitivity.

SOLUTION: The thermosensitive lithographic printing original plate comprises a thermosensitive layer containing at least one component selected from the group consisting of thermoplastic polymer fine particles, thermosetting polymer fine particles, polymer fine particles having a heat reactive functional group and a microcapsule containing a compound having a heat reactive functional group on a porous base in which a surface layer is porous and a photothermal conversion agent is embedded.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-19314

(P2002-19314A)

(43)公開日 平成14年1月23日(2002.1.23)

l 55 5 04 5	別記号 01 05		F I B 4 B 4		1/14 1/055		501	2	├-}^(参考) H025 H084
55 5 04 5	0 5		B 4		•		501	_	
)4 5	0 5			1 C	1/055		501	2	HORA
			~ ~ ~					_	11004
5	1.4		G U	3 F	7/004		505	2	H114
	14						514		
32 5	0 1				7/032		501		
		審査請求	朱蕭求	請求	項の数1	OL	(全 21	頁)	最終頁に続く
特願2000	-202667(P2000	-202667)	(71)	出願人			ルム株式:	会社	
平成12年	平成12年7月4日(2000.7.4)								<u> </u>
			(72)	発明者	星彩				
					静岡県	榛原郡	吉田町川川	尻4000看	蜂地 富士写
			İ		真フイ	ルム株:	式会社内		
			(72)	発明者	前本	一夫			
					静岡県	像原郡	吉田町川)	元4000 ₹	路地 富士写
					真フイ	ルム株	式会社内		
			(74)	人郵升	. 1001050	647			
			J		弁理士	小栗	昌平	Ø 44	当)
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•	特願2000-202667(P2000-202667) 平成12年7月4日(2000.7.4)	平成12年7月4日(2000.7.4) (72)	平成12年7月4日(2000.7.4) (72)発明者 (72)発明者	電士写 平成12年7月4日(2000.7.4)	審士写真フイル 神奈川県南足 (72)発明者 星 聡 静岡県榛原郡 真フイルム株 (72)発明者 前本 一夫 静岡県榛原郡 真フイルム株 (74)代理人 100105647	審士写真フイルム株式: 神奈川県南足柄市中沼 (72)発明者 星 聡 静岡県榛原郡吉田町川	審士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地 (72)発明者 星 聡 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番 真フイルム株式会社内 (72)発明者 前本 一夫 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番 真フイルム株式会社内 (74)代理人 100105647

政終貝に就く

(54) 【発明の名称】 感熱性平版印刷用原板

(57)【要約】

【課題】 露光後、処理を行うことなく直接印刷機に装着して印刷することが可能であり、耐刷性および汚れ難さに優れ、しかも、感度の改良された感熱性平版印刷用原板を提供する。

【解決手段】 表面層が多孔質で光熱変換剤が埋め込まれている多孔質基板上に、熱可塑性ポリマー微粒子、熱硬化性ポリマー微粒子、熱反応性官能基を有するポリマー微粒子、及び熱反応性官能基を有する化合物を内包するマイクロカプセルから選ばれた少なくとも一つの成分を含有する感熱層を有する感熱性平版印刷用原板。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面層が多孔質で光熱変換剤が埋め込まれている多孔質基板上に、熱可塑性ポリマー微粒子、熱硬化性ポリマー微粒子、熱反応性官能基を有するポリマー微粒子、及び熱反応性官能基を有する化合物を内包するマイクロカプセルから選ばれた少なくとも一つの成分を含有する感熱層を有する感熱性平版印刷用原板。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コンピュータ・ツウ・プレートシステム用の感熱性平版印刷用原板に関する。より詳しくは、デジタル信号に基づいた赤外線走査露光による画像記録が可能であり、画像記録したものを現像処理することなしに、そのまま印刷機に装着して印刷することが可能な感熱性平版印刷用原板に関する。

[0002]

【従来の技術】近年進展が目覚ましいコンピュータ・ツウ・プレートシステム用刷版については、多数の研究がなされている。その中で、一層の工程合理化と廃液処理問題の解決を目指すものとして、露光後、現像処理することなしにそのまま印刷機に装着して印刷できる平版印刷用原板が研究され、種々の方法が提案されている。

【0003】有望な方法の一つは、熱可塑性ポリマー微粒子や親油性物質を内包したマイクロカプセルなどの微粒子を親水性樹脂などのマトリックス中に分散した親水層(感熱層)を有する感熱性平版印刷用原板を用いる方法である。親水層に熱を加えると、熱可塑性ポリマー微粒子が溶融合体し、もしくは内包された親油性物質がマイクロカプセル外に滲出して、親水層表面を親油性画像部に変換する。このようにして得られた親油性画像部に変換する。このようにして得られた親油性画像部と親水性樹脂マトリックスからなる親水性非画像部との表面構成を印刷面として用いることにより、完全無処理で、湿し水使用の平版印刷を行えることが知られている。

【0004】また、上記親水層を親水性表面を有する支持体上に設け、熱により生成した親油性画像部以外を、印刷機のシリンダーを回転しながら湿し水とインキを供給することによって、あたかも現像処理したように除去してしまう方法(機上現像法)も知られている。すなわち、印刷用原版を露光後、そのまま印刷機に装着し、通40常の印刷過程の中で現像処理が完了する製版方式であり、印刷版としては、熱により生成した親油性画像部と支持体の親水性表面である非画像部とからなる表面構成有する。

【0005】更に、このような無処理もしくは機上現像 に適した平版印刷用原板は、明室に置かれた印刷機にそ のまま装着されるので、室内光に当たっても問題ない性 質(明室取り扱い性)を有することが必要とされる。

【0006】例えば、特開平7-1849号公報、同7 質材料、多孔質基板形成法、光熱変換剤および多孔質-1850号公報、同10-6468号公報および同1 50 料に光熱変換剤を埋め込む手段等について説明する。

1-70756号公報には、親水性バインダーポリマー中に熱により画像部に転換する親油性成分を内包するマイクロカプセルを分散した親水層を有する感熱性平版印刷原板が開示されており、熱の印加後、無処理で印刷できることが記載されている。

【0007】また、例えば、日本特許2938397号公報、特開平9-127683号公報およびWO99-10186号には、親水性バインダーポリマー中に熱可塑性疎水性重合体の微粒子を分散させた感光層を親水性支持体上に設けた平版印刷用原板が開示されている。この公報には、該平版印刷用原板において、赤外線レーザー露光して熱可塑性疎水性重合体の微粒子を熱により合体させて画像形成した後、印刷機シリンダー上に版を取付け、湿し水および/またはインキにより機上現像できることが記載されている。

[0008]

20

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これらの感熱性平版印刷用原板は、感度が低いという問題があった。特に、高熱伝導率の基板を用いた場合、赤外線を吸収して発生した熱は、基板に拡散して有効に伝達されず、平版印刷用原板としては低感度であった。すなわち、本発明の目的は、露光後、処理を行うことなく直接印刷機に装着して印刷することが可能であり、耐刷性および汚れ難さに優れ、しかも、感度の改良された感熱性平版印刷用原板を提供することである。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記の目的を達成するために、多孔質材料の特性に着目して、その特性を顕著に発現させる手段が必要と考えてその手段を検討し、多孔質基板に光熱変換剤を埋め込むことによって、熱拡散を少なくすると同時にレーザー光に対する熱応答感度を高め、より低いレーザー光の照射で画像ができ、かつ照射を下げたことによって高精細な描画ができる平版印刷版を完成させるに至った。すなわち、本発明は、以下のとおりである。

【0010】表面層が多孔質で光熱変換剤が埋め込まれている多孔質基板上に、熱可塑性ポリマー微粒子、熱硬化性ポリマー微粒子、熱反応性官能基を有するポリマー微粒子、及び熱反応性官能基を有する化合物を内包するマイクロカプセルから選ばれた少なくとも一つの成分を含有する感熱層を有する感熱性平版印刷用原板。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

[本発明にかかわる多孔質基板]本発明の多孔質基板とは、本来、基板自体が多孔質の基板であっても良いし、本来は多孔質でない基板の表面を多孔質材料で被覆しても良い。以下に、本発明において用いられる基板、多孔質材料、多孔質基板形成法、光熱変換剤および多孔質材料に光熱変換剤を埋め込む手段等について説明する。

【0013】本発明に用いられる多孔質材料としては、 孔径が10Åから10μmの平均孔径を有しているもの 10 なら特に限定するものではないが、金属化合物が好まし い。具体例としては、例えば、酸化アルミニウム、酸化 珪素、酸化亜鉛、酸化イットリウム、酸化チタン、酸化 ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化パナジウム、酸化 ニオブ、酸化タンタル、酸化モリブデン、酸化タングス テン、酸化クロム、酸化スズ、チッ化珪素、チッ化アル ミニウム、チッ化ホウ素、チッ化チタン、チッ化ジルコ ニウム、チッ化ハフニウム、チッ化パナジウム、チッ化 ニオブ、チッ化タンタル、チッ化モリブデン、チッ化タ ングステン、チッ化クロムなどがあげられる。また、ケ 20 イ化チタン、ケイ化ジルコニウム、ケイ化ハフニウム、 ケイ化パナジウム、ケイ化ニオブ、ケイ化タンタル、ケ イ化モリブデン、ケイ化タングステン、ケイ化クロムな どがあげられる。ホウ化チタン、ホウ化ジルコニウム、 ホウ化ハフニウム、ホウ化パナジウム、ホウ化ニオブ、 ホウ化タンタル、ホウ化モリブデン、ホウ化タングステ ン、ホウ化クロムなどがあげられる。また、炭化珪素、 炭化チタン、炭化ホウ素、炭化ジルコニウム、炭化ハフ ニウム、炭化パナジウム、炭化ニオブ、炭化タンタル、 炭化モリブデン、炭化タングステン、炭化クロムなどが 30 あげられる。

【0014】また、単体のみではなく混合物でも良い。例えば珪素、アルミニウム、酸素、窒素からなるサイアロンを用いることもできる。また、チタン酸鉛、ジルコン酸鉛、チタン酸ジルコン酸ランタン酸鉛、ムライト、フェライト、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、チッ化ホウ素ーチッ化アルミニウムなどである。ここにあげなかったものでも多孔質であれば用いることができる。中でもアルミニウム及び周期律表の4A族から6A族金属元素の化合物が望40ましい。周期律表の4A族から6A族の金属とはチタン、ジルコニウム、ハフニウム、パナジウム、ニオブ、タンタル、モリブデン、タングステン、クロムを総称して言う。

極酸化膜は有機または無機の物質または染料に高い吸着能を有しているので光熱変換物質を埋め込むのに適しているので望ましい。厚みは 0.01μ m $\sim10\mu$ mが望ましく、好ましくは $0.05\sim5\mu$ mである。さらに好ましくは $0.2\sim3\mu$ mである。また照射光の作用を充分に発現させるには厚みが 0.01μ m以上あることが好都合である。

【0016】基板の表面の陽極酸化処理は、次に示す電 解質水溶液の中で行うことができる。

- (1) 硫酸、リン酸、硝酸、ホウ酸などの無機酸から選択された1つ以上を含む水溶液。
- (2) 上記無機酸の他にさらに過酸化水素を含む混合水 溶液。
- (3) 上記(1) の無機酸の他に、さらにそのアルカリ 金属塩及びアルカリ土類金属塩の一つ以上を含む混合水 溶液。
- (4) 上記(1) の無機酸のアンモニウム塩を一つ以上 含む水溶液または、エチレングリコールと水の混合液を 溶媒とした溶液。
- (5)シュウ酸、酒石酸、クエン酸、酢酸、乳酸、琥珀酸、グルタミン酸、スルホサリチル酸、ナフタレンジスルホン酸などの有機酸から選択された一つ以上を含む水溶液。
- (6) 上記有機酸のアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の一つ以上を含む水溶液。
- (7)上記(5)の有機酸のアンモニウム塩を一つ以上 含む水溶液または、エチレングリコールと水の混合液を 溶媒とした溶液。
- (8) Na、K、Ca、Li、Mgの水酸化物、水溶性の炭素塩、水酸化アンモニウムなどのアルカリ水溶液から選択された一つ以上を含む水溶液。
- (9) グリセロリン酸、そのアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の少なくとも一つを含んで、さらに好ましくは酢酸、そのアルカリ金属塩及びアルカリ土類金属塩の少なくとも一つを含む水溶液。
- (10) 以上の $(1) \sim (9)$ の溶液成分を組み合わせて含む水溶液。

【0017】上記の電解質水溶液の濃度は、電解質の種類によって適宜決められ、また、陽極酸化の処理条件は、選択した電解質水溶液に依存して種々の条件が選ばれるが、一般的には電解質の濃度が $0.001\sim3\,\mathrm{mol/L}$ 、校ましくは $0.005\sim1\,\mathrm{mol/L}$ 、液温は $5\sim70\,\mathrm{C}$ 、好ましくは $20\sim50\,\mathrm{C}$ 、電流密度 $1\sim60\,\mathrm{A/d}$ 電圧 $1\sim500\,\mathrm{V}$ 好ましくは $100\sim400\,\mathrm{V}$ 、電解時間 $100\sim10\,\mathrm{C}$ 分好ましくは $1\sim5\,\mathrm{C}$ の範囲にあれば適当である。個々の代表的な電解質水溶液の適切な陽極酸化条件は、実施例に示す。陽極酸化皮膜の厚みは、 $0.001\sim10\,\mathrm{\mu}\,\mathrm{m}$ 程度、好ましくは $0.1\sim5.0\,\mathrm{\mu}\,\mathrm{m}$ 、特に好ましくは $0.3\sim1.0\,\mathrm{\mu}\,\mathrm{m}$ である。

【0018】また、陽極酸化した表面にある種の金属をドーピングすることが、たとえば熱拡散などに有効な場合があり、この目的にはイオン化傾向が小さい金属のドーピングが適しており、Pt、Pd、Au、Ag、Cu、Ni、Fe、Coをドーピングするのが好ましい。また、これらの好ましい金属を複数ドーピングしてもよい

【0019】遷移金属板は、金属板の単一構成のもの及び支持体で補強されたものを含めて、陽極酸化に先立って表面の粗面化処理を施してもよい。粗面化によって表 10面を親水性にしたときの保水性を高めることができ、したがって画像と非画像部の識別性を向上させることができる。粗面化処理を施す場合には、必要により、粗面化処理に先立って表面の圧延油を除去するための例えば界面活性剤、有機溶剤またはアルカリ性水溶液などによる脱脂処理が行われる。

【0020】金属板(薄層)の表面の粗面化処理は、種 々の方法により行われるが、例えば、機械的に粗面化す る方法、電気化学的に表面を溶解粗面化する方法および 化学的に表面を選択溶解させる方法のいずれか又はそれ 20 らの組み合わせによって行われる。機械的方法として は、ボール研磨法、ブラシ研磨法、ブラスト研磨法、バ フ研磨法などの公知の方法を用いることができる。ま た、電気化学的な粗面化法もアルミニウム金属表面の粗 面化の方法として公知の方法、たとえば塩酸または硝酸 電解液中で交流または直流により行う方法を遷移金属表 面の粗面化に適用することができる。また、特開昭54 -63902号に開示されているように両者を組み合わ せた方法も利用することができる。また、化学的な粗面 化処理は、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、珪酸ナ トリウム、ピロリン酸ナトリウムなどから選ばれるアル カリ性の塩類混合水溶液へ浸漬して金属表面をエッチン グして行われる。

【0021】本発明の多孔質基板に用いられる光熱変換物質としては、光を吸収して熱に変換して放出するものであれば特に制限はなく、従来から公知のものであれば使用できる。紫外から近赤外にわたる波長領域において光の波長を有効に吸収し効率よく熱エネルギーに変換できる色素が好ましく用いられる。本発明の特に好ましい態様では半導体レーザー光照射により発熱させるため600nmから2000nmに吸収極大を示し、可視域での吸収がないもしくは小さい近赤外吸収剤が好ましい。

【0022】赤外線レーザーを用いる場合の近赤外吸収 剤の具体例として、色素を例に挙げる。好ましい色素 は、赤外線を吸収して熱エネルギーに変換する性質をも つ染料や顔料である。好ましい顔料や染料、とくに顔料 としては、シアニン色素、スクワリリウム色素、メチン 系色素、ナフトキノン系色素、キノンイミン系色素、キ ノンジイミン系色素、キノンジイミン系色素、ピリリウ ム塩系色素、ナフトキノン系色素、フタロシアニン系色 50

素、ナフトロシアニン系色素、ジチオール金属錯体色 素、アントラキノン系色素、アゾ系色素、トリスアゾ系 色素、ポルフィリン系顔料、モルフォリン系顔料、フタ ロシアニン系顔料などが挙げられる。

【0023】好ましい顔料や染料の具体例としては、コ バルトグリーン(C. I. 77335), エメラルドグ リーン(C. I. 77410), フタロシアニンブルー (C. I. 74100), 銅フタロシアニン(C. I. 74160), ウルトラマリン (C. I. 7700 7), 紺青(C. I. 77510), コバルト紫(C. I. 77360), パリオジェン赤310 (C. I. 7 1155), パーマネントレッドBL(C. I. 711 37),ペリレン赤(C. I. 71140),ローダミ ンレーキB(C. I. 45170:2), ヘリオボルド -BL (C. I. 14830), ライトファーストレッ ドトーナーR (C. I. 12455), ファーストスカ ーレットVD、リゾールファーストスカーレットG (C. I. 12315), パーマネントブラウンFG (C. I. 12480), インダンスレンブリリアント オレンジRK(C. I. 59300), 赤口黄鉛(C. I. 77601), ハンザイエロー10G(C. I. 1 1710), チタンイエロー (C. I. 77738), 亜鉛黄(C. I. 77955), クロムイエロー(C. I. 77600) などが挙げられるほか、静電記録用ト ナーに用いられる各種の顔料も好ましく用いることがで

【0024】そのほか、マラカイトグリーンしゅう酸、 キニザリン、2-(α-ナフチル)-5-フェニルオキ サゾール、オイルピンク#312、オイルグリーンB G、オイルブルーBOS、オイルブラックBY、オイル ブラックBS、オイルブラックT-505(以上、オリ エント化学工業(株)製)、ベーシックフクシン、m-クレゾールパープル、シアノーpージエチルアミノフェ ニルアセトアニリド、あるいは特開昭62-29324 7号公報、特願平7-335145号公報に記載されて いる染料を挙げることができる。中でも、フタロシアニ ングリーン、フタロシアニンブルーなど銅、コバルト、 ニッケル、鉄のフタロシアニン錯塩、3,3°-エチル メソエチルナフトチア(オキサ)ジカルボシアニン、 3、3'-エチルナフトチア(オキサ)トリカルボシア ニンなどで代表されるジカルボシアニンやトリカルボシ アニン色素が好ましい。

【0025】無機顔料としては、例えばカーボンブラック、二酸化チタン、酸化亜鉛、プルシアンブルー、硫化カドミウム、酸化鉄、並びに鉛、亜鉛、バリウム及びカルシウムのクロム酸塩などを好適に用いることができる。また、酸化物、チッ化物、ケイ化物、ホウ化物、炭化物などのセラミックの微粒子を充填することもできる。酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ハフニウム、酸化パナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタル、酸化モリ

ブデン、酸化タングステン、酸化クロムなどがあげられ る。また、チッ化チタン、チッ化ジルコニウム、チッ化 ハフニウム、チッ化パナジウム、チッ化ニオブ、チッ化 タンタル、チッ化モリブデン、チッ化タングステン、チ ッ化クロムなどがあげられる。また、ケイ化チタン、ケ イ化ジルコニウム、ケイ化ハフニウム、ケイ化パナジウ ム、ケイ化ニオブ、ケイ化タンタル、ケイ化モリブデ ン、ケイ化タングステン、ケイ化クロムなどがあげられ る。ホウ化チタン、ホウ化ジルコニウム、ホウ化ハフニ ウム、ホウ化パナジウム、ホウ化ニオブ、ホウ化タンタ ル、ホウ化モリブデン、ホウ化タングステン、ホウ化ク ロムなどがあげられる。また、炭化チタン、炭化ジルコ ニウム、炭化ハフニウム、炭化パナジウム、炭化ニオ ブ、炭化タンタル、炭化モリブデン、炭化タングステ ン、炭化クロムなどがあげられる。また、単体のみでは なく混合物でも良い。また、染料としては酸性塗料、直 接染料、分散染料、油溶性染料、含金属油溶性染料など を好適に用いることができる。

【0026】多孔質材料に光熱変換物質を埋め込む手段 として交流電流により処理する方法いわゆる電解着色法 20 と、光熱変換物質を溶剤に溶解あるいは微粒子状に分散 し、その溶液又は分散液に多孔質材料を浸せきすること により、多孔質表面に吸着させる方法、いわゆる染色法 を用いることができる。

【0027】次に電解着色法について述べる。電解着色 法は、陽極酸化を施したアルミニウムまたはアルミニウ ム合金を電解液中で交流電解することにより陽極酸化孔 中に金属酸化物あるいは金属水酸化物が充填されること はよく知られている。この方法をさらに詳しく述べる と、つぎのとおりである。まず、多孔質材料あるいは多 孔質材料を被覆した基板を光熱変換物質を溶解した電解 液中に浸漬してこれを陽極とし、交流通電を行なう。交 流電圧は5~50V、好ましくは10~30Vである。 【0028】電解液中に使用される金属塩としては種々 のものがあるが、一例をあげると、ニッケル、コバル ト、クロム、銅、マグネシウム、鉄、カドニウム、チタ ン、マンガン、モリブテン、カルシウム、パナジウム、 錫、鉛、亜鉛などの金属の硝酸塩、硫酸塩、リン酸塩、 塩酸塩、クロム酸塩などの無機酸塩、シュウ酸塩、酢酸 塩、酒石酸などの有機酸塩などがあるが、着色進行度を 増大させるためには、これらのうちから3種以上の金属 塩または2種以上の金属塩と強還元性化合物との混合物 を含有する電解が使用される。これにより融通性が増大 する。これらの金属塩の濃度は、合計量で5~500g **/リットル、好ましくは10~250g/リットルであ** る。本発明において使用される強還元性化合物として は、たとえば、亜二チオン酸ナトリウム、亜二チオン酸 亜鉛などの亜ニチオン酸塩、チオ硫酸アンモニウム、チ オ硫酸ナトリウム、チオ硫酸カリウム、チオ硫酸鉄など のチオ硫酸塩、亜硫酸水素ナトリウム、亜硫酸水素カリ 50 ン、アクリロニトリル、ビニルカルバゾールなどのモノ

ウムなどの亜硫酸水素塩、亜硫酸、亜硫酸アンモニウ ム、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウムなどの亜硫酸 塩、チオグリコール酸、チオグリコール酸アンモニウ ム、チオグリコール酸ナトリウム、チオグリコール酸カ リウム、チオグリコール酸リチウムなどのチオグリコー ル酸塩がある。これらは、0.05~10g/リットル 好ましくは0.5~3g/リットルの濃度で使用され る。

【0029】また、上記電解液には、通常、硫酸、硝 酸、塩酸、リン酸、ホウ酸、チオシアン酸、クロム酸な どのような無機酸またはシュウ酸、酢酸、プロピオン 酸、ギ酸、酒石酸、リンゴ酸などのような有機酸、ある いはそれらのアンモニウム塩、アミノ塩またはイミノ塩 の少なくとも1種が添加される。その添加濃度は5~2 50g/リットルである。また、交流着色電解におい て、初期印加電圧よりも低い電圧に変動して電解を行な うことにより付廻り性はさらに向上する。そして、その 低下変動させるべき電圧差は好ましくは1~10Vであ り、また、変動させるべき時期は、通常通電後2分以 内、好ましくは5~60秒間である。また、上記電解液 には前記した光熱変換物質を添加して用いることもでき

【0030】上記の方法で電解着色された皮膜は、必要 により、沸とう水、薬品封孔または加圧水蒸気など公知 の手段により封孔処理が施される。また、その封孔処理 を施したのち、あるいは封孔処理を施すことなく、必要 によりさらに樹脂塗料による浸漬塗装または電着塗装を 行なって表面保護を行ってもよい。また、有機染料また は無機化合物を吸着させる方法(染色法)などを用いる ことができる。染色法は前記した光熱変換物質の有機染 料、無機化合物などを溶剤に溶解あるいは微粒子に分散 して使用する。その溶液に多孔質材料を浸せきすること により、多孔質表面に吸着させる方法である。溶媒は光 熱変換物質を溶解するものであれば何でも良いが、中で も水が望ましい。

【0031】〔感熱層〕本発明の感熱層は、熱可塑性ポ リマー微粒子、熱硬化性ポリマー微粒子、熱反応性官能 基を有するポリマー微粒子、及び熱反応性官能基を有す る化合物を内包するマイクロカプセルから選ばれた少な くとも一つの成分を含有する。

【0032】本発明に好適な熱可塑性微粒子ポリマーと しては、1992年1月のResearchDisclosure No. 33 303、特開平9-123387号公報、同9-131 850号公報、同9-171249号公報、同9-17 1250号公報およびEP931647号公報などに記 載の熱可塑性微粒子ポリマーを好適なものとして挙げる ことができる。具体例としては、エチレン、スチレン、 塩化ビニル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、メ タクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、塩化ビニリデ

マーのホモポリマーまたはコポリマーあるいはそれらの 混合物を挙げることができる。その中で、より好適なも のとして、ポリスチレン、ポリメタクリル酸メチルを挙 げることができる。

【0033】本発明に好適な熱硬化性樹脂としては、フェノール骨格を有する樹脂、尿素系樹脂(例えば、尿素 又はメトキシメチル化尿素など尿素誘導体をホルムアル デヒドなどのアルデヒド類により樹脂化したもの)、メラミン系樹脂(例えば、メラミン又はその誘導体をホルムアルデヒドなどのアルデヒド類により樹脂化したもの)、アルキド樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、エポキシ樹脂等を挙げることができる。

【0034】好適なフェノール骨格を有する樹脂としては、例えば、フェノール、クレゾールなどをホルムアルデヒドなどのアルデヒド類により樹脂化したフェノール樹脂、ヒドロキシスチレン樹脂、Nー(pーヒドロキシフェニル)メタクリルアミドなどのフェノール骨格を有するメタクリルアミド又はアクリルアミド樹脂、及びNー(pーヒドロキシフェニル)メタクリレートなどのフェノール骨格を有するメタクリレート又はアクリレート20樹脂を挙げることができる。中でも、特に好ましいのは、フェノール骨格を有する樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂及びエポキシ樹脂である。

【0035】本発明に用いられる熱硬化性化合物を含有する微粒子は、平均粒径は 0.01μ m $\sim 2.0\mu$ mが好ましい。このような微粒子の合成方法としては、これら化合物を非水溶性の有機溶剤に溶解し、これを分散剤が入った水溶液と混合乳化し、さらに熱をかけて、有機溶剤を飛ばしながら微粒子状に固化させる方法がある。また、熱硬化性樹脂を合成する際に微粒子化してもよい。しかし、これらの方法に限らない。

【0036】本発明に用いる熱反応性官能基を有するポリマー微粒子及び熱反応性官能基を有する化合物を内包するマイクロカプセルの熱反応性官能基としては、重合反応を行うエチレン性不飽和基(例えば、アクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、アリル基など)、付加反応を行うイソシアナート基もしくはそのブロック体及びその反応相手である活性水素原子を有する官能基

(例えば、アミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基など)、同じく付加反応を行うエポキシ基及びその反応 40 相手であるアミノ基、カルボキシル基もしくはヒドロキシル基、縮合反応を行うカルボキシル基とヒドロキシル基もしくはアミノ基、開環付加反応を行う酸無水物とアミノ基もしくはヒドロキシル基などを挙げることができる。しかし、化学結合が形成されるならば、どのような反応を行う官能基でも良い。

【0037】本発明の感熱層に用いる熱反応性官能基を 有する微粒子ポリマーとしては、アクリロイル基、メタ クリルロイル基、ビニル基、アリル基、エポキシ基、ア ミノ基、ヒドロキシル基、カルボキシル基、イソシアネ 50 ート基、酸無水物およびそれらを保護した基を有するものを挙げることができる。これらの官能基のポリマー粒子への導入は、重合時に行ってもよいし、重合後に高分子反応を利用して行ってもよい。

10

【0038】重合時に導入する場合は、これらの官能基 を有するモノマーを乳化重合あるいは懸濁重合すること が好ましい。そのような官能基を有するモノマーの具体 例として、アリルメタクリレート、アリルアクリレー ト、ビニルメタクリレート、ビニルアクリレート、グリ 10 シジルメタクリレート、グリシジルアクリレート、2-イソシアネートエチルメタクリレートあるいはそのアル コールなどによるブロックイソシアナート、2ーイソシ アネートエチルアクリレートあるいはそのアルコールな どによるブロックイソシアナート、2-アミノエチルメ タクリレート、2-アミノエチルアクリレート、2-ヒ ドロキシエチルメタクリレート、2-ヒドロキシエチル アクリレート、アクリル酸、メタクリル酸、無水マレイ ン酸、2官能アクリレート、2官能メタクリレートなど を挙げることができるが、これらに限定されない。これ らのモノマーと共重合可能な、熱反応性官能基をもたな いモノマーとしては、例えば、スチレン、アルキルアク リレート、アルキルメタクリレート、アクリロニトリ ル、酢酸ビニルなどを挙げることができるが、熱反応性 官能基をもたないモノマーであれば、これらに限定され ない。熱反応性官能基の導入を重合後に行う場合に用い る高分子反応としては、例えば、WO96-34316 号公報に記載されている高分子反応を挙げることができ る。

【0039】上記の熱反応性官能基を有する微粒子ポリマーの中で、微粒子ポリマー同志が熱により合体するものが好ましく、その表面は親水性で、水に分散するものが、特に好ましい。微粒子ポリマーのみを塗布し、凝固温度よりも低い温度で乾燥して作製した時の皮膜の接触角(空中水滴)よりも低くなることが好ましい。このように微粒子ポリマー表面を親水性にするには、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコールなどの親水性ポリマーあるいはオリゴマー、または親水性低分子化合物を微粒子ポリマー表面に吸着させてやれば良いが、その方法はこれらに限定されるものではない。

【0040】これらの熱反応性官能基を有する微粒子ポリマーの凝固温度は、70℃以上が好ましいが、経時安定性を考えると100℃以上がさらに好ましい。上記の微粒子ポリマーの平均粒径は、0.01~20μmが好ましいが、その中でも0.05~2.0μmがおらに好ましく、特に0.1~1.0μmが最適である。この範囲内で良好な解像度および経時安定性が得られる。これらの反応性官能基を有する微粒子ポリマーの添加量は、感熱層固形分の20重量%以上が好ましく、40重量%

以上がさらに好ましい。

【0041】本発明に用いられるマイクロカプセルは、 熱反応性官能基を有する化合物を内包している。この熱 反応性官能基を有する化合物としては、重合性不飽和 基、ヒドロキシル基、カルボキシル基あるいはカルボキ シレート基あるいは酸無水物、アミノ基、エポキシ基、 および、イソシアナート基あるいはそのブロック体から 選ばれた少なくとも一個の官能基を有する化合物を挙げ ることができる。

【0042】重合性不飽和基を有する化合物としては、エチレン性不飽和結合、例えばアクリロイル基、メタクリロイル基、ビニル基、アリル基などを少なくとも1個、好ましくは2個以上有する化合物が好ましく、この様な化合物群は当該産業分野において広く知られるものであり、本発明においては、これらを特に限定なく用いることができる。これらは、化学的形態としては、モノマー、プレポリマー、すなわち2量体、3量体およびオリゴマー、またはそれらの混合物、あるいはそれらの共重合体である。

【0043】例として、不飽和カルボン酸(例えば、ア クリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、クロトン酸、イ ソクロトン酸、マレイン酸など)、そのエステルおよび アミドが挙げられ、好ましくは、不飽和カルボン酸と脂 肪族多価アルコールとのエステルおよび不飽和カルボン 酸と脂肪族多価アミンとのアミドが挙げられる。また、 ヒドロキシル基、アミノ基、メルカプト基等の求核性置 換基を有する不飽和カルボン酸エステルまたは不飽和カ ルボン酸アミドと、単官能もしくは多官能イソシアネー トまたはエポキシドとの付加反応物、および、単官能も しくは多官能のカルボン酸との脱水縮合反応物等も好適 に使用される。また、イソシアナート基やエポキシ基な どの親電子性置換基を有する不飽和カルボン酸エステル またはアミドと、単官能もしくは多官能のアルコール、 アミンおよびチオールとの付加反応物、さらに、ハロゲ ン基やトシルオキシ基等の脱離性置換基を有する不飽和 カルボン酸エステルまたはアミドと、単官能もしくは多 官能アルコール、アミンおよびチオールとの置換反応物 も好適である。また、別の好適な例として、上記の不飽 和カルボン酸を、不飽和ホスホン酸あるいはクロロメチ ルスチレンに置き換えた化合物を挙げることができる。 【0044】不飽和カルボン酸と脂肪族多価アルコール とのエステルである重合性化合物の具体例としては、ア クリル酸エステルとして、エチレングリコールジアクリ レート、トリエチレングリコールジアクリレート、1, 3-ブタンジオールジアクリレート、テトラメチレング リコールジアクリレート、プロピレングリコールジアク リレート、ネオペンチルグリコールジアクリレート、ト リメチロールプロパンジアクリレート、トリメチロール プロパントリアクリレート、トリメチロールプロパント

チロールエタントリアクリレート、ヘキサンジオールジアクリレート、1,4ーシクロヘキサンジオールジアクリレート、カトラエチレングリコールジアクリレート、ペンタエリスリトールジアクリレート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールペナテクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールトリアクリレート、ソルビトールインタアクリレート、トリス(アクリロイルオキシエチル)イソシアヌレート、ポリエステルアクリレートオリゴマー等を挙げることができる。

12

【0045】メタクリル酸エステルとしては、テトラメ チレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリ コールジメタクリレート、ネオペンチルグリコールジメ タクリレート、トリメチロールプロパントリメタクリレ ート、トリメチロールエタントリメタクリレート、エチ レングリコールジメタクリレート、1,3ーブタンジオ ールジメタクリレート、ヘキサンジオールジメタクリレ ート、ペンタエリスリトールジメタクリレート、ペンタ エリスリトールトリメタクリレート、ペンタエリスリト ールテトラメタクリレート、ジペンタエリスリトールジ メタクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサメタク リレート、ソルビトールトリメタクリレート、ソルビト ールテトラメタクリレート、ビス〔p ー (3 - メタクリ ロイルオキシー2ーヒドロキシプロポキシ)フェニル] ジメチルメタン、ビスー〔p-(メタクリロイルオキシ エトキシ)フェニル]ジメチルメタン等を挙げることが 30 できる。

【0046】イタコン酸エステルとしては、エチレングリコールジイタコネート、プロピレングリコールジイタコネート、1,3ーブタンジオールジイタコネート、1,4ーブタンジオールジイタコネート、テトラメチレングリコールジイタコネート、ペンタエリスリトールジイタコネート、ソルビトールテトライタコネート等を挙げることができる。

【0047】クロトン酸エステルとしては、エチレングリコールジクロトネート、テトラメチレングリコールジクロトネード、ペンタエリスリトールジクロトネート、ソルビトールテトラジクロトネート等を挙げることができる。イソクロトネート、ペンタエリスリトールジイソクロトネート、ソルビトールテトライソクロトネート等を挙げることができる。マレイン酸エステルとしては、エチレングリコールジマレート、トリエチレングリコールジマレート、ペンタエリスリトールジマレート、ソルビトールテトラマレート等を挙げることができる。【0048】その他のエステルの例として「何々ば特

プロパントリアクリレート、トリメチロールプロパント 【0048】その他のエステルの例として、例えば、特 リス(アクリロイルオキシプロピル)エーテル、トリメ 50 公昭46-27926、特公昭51-47334号、特

開昭57-196231号記載の脂肪族アルコール系エ ステル類や、特開昭59-5240号、特開昭59-5 241号、特開平2-226149号記載の芳香族系骨 格を有するもの、特開平1-165613号記載のアミ ノ基を含有するもの等を挙げることができる。

13

【0049】また、脂肪族多価アミン化合物と不飽和力 ルボン酸とのアミドのモノマーの具体例としては、メチ レンビスーアクリルアミド、メチレンビスーメタクリル アミド、1,6-ヘキサメチレンビス-アクリルアミ ド、1、6-ヘキサメチレンビスーメタクリルアミド、 ジエチレントリアミントリスアクリルアミド、キシリレ ンビスアクリルアミド、キシリレンビスメタクリルアミ ド等を挙げることができる。その他の好ましいアミド系 モノマーの例としては、特公昭54-21726号記載 のシクロヘキシレン構造を有すものを挙げることができ る。

【0050】また、イソシアネートと水酸基の付加反応 を用いて製造されるウレタン系付加重合性化合物も好適 であり、そのような具体例としては、例えば、特公昭4 8-41708号公報中に記載されている1分子に2個 以上のイソシアネート基を有するポリイソシアネート化 合物に、下記式(I)で示される水酸基を有する不飽和 モノマーを付加させた1分子中に2個以上の重合性不飽 和基を含有するウレタン化合物等が挙げられる。

【0051】一般式(I)

 $CH_2 = C (R^1) COOCH_2 CH (R^2) OH$ (ただし、R'およびR'は、HまたはCH₂を示す。) 【0052】また、特開昭51-37193号、特公平 2-32293号、特公平2-16765号に記載され ているようなウレタンアクリレートや、特公昭58-4 30 9860号、特公昭56-17654号、特公昭62-39417号、特公昭62-39418号記載のエチレ ンオキサイド系骨格を有するウレタン化合物も好適なも のとして挙げることができる。

【0053】さらに、特開昭63-277653号、特 開昭63-260909号、特開平1-105238号 に記載される、分子内にアミノ構造やスルフィド構造を 有するラジカル重合性化合物を好適なものとして挙げる ことができる。

【0054】その他の好適なものの例としては、特開昭 48-64183号公報、特公昭49-43191号公 報、同52-30490号公報の各公報に記載されてい るようなポリエステルアクリレート類、エポキシ樹脂と (メタ) アクリル酸を反応させたエポキシアクリレート 類等の多官能のアクリレートやメタクリレートを挙げる ことができる。また、特公昭46-43946号公報、 特公平1-40337号公報、同1-40336号公報 記載の特定の不飽和化合物や、特開平2~25493号 公報に記載のビニルホスホン酸系化合物等も好適なもの として挙げることができる。また、ある場合には、特開 50 ポリマーの析出による方法、米国特許3796669号

昭61-22048号公報記載のペルフルオロアルキル 基を含有する化合物も好適に使用される。さらに日本接 着協会誌、20巻7号、300~308ページ(198 4年)に光硬化性モノマーおよびオリゴマーとして紹介 されているものも好適に使用することができる。

【0055】好適なエポキシ化合物としては、グリセリ ンポリグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジ グリシジルエーテル、ポリプロピレンジグリシジルエー テル、トリメチロールプロパンポリグリシジルエーテ ル、ソルビトールポリグリシジルエーテル、ビスフェノ ール類あるいはポリフェノール類もしくはそれらの水素 添加物のポリグリシジルエーテルなどが挙げられる。

【0056】好適なイソシアネート化合物としては、ト リレンジイソシアネート、ジフェニルメタンジイソシア ネート、ポリメチレンポリフェニルポリイソシアネー ト、キシリレンジイソシアネート、ナフタレンジイソシ アネート、シクロヘキサンフェニレンジイソシアネー ト、イソホロンジイソシアネート、ヘキサメチレンジイ ソシアネート、シクロヘキシルジイソシアネート、ある いは、それらをアルコールあるいはアミンでブロックし た化合物を挙げることができる。

【0057】好適なアミン化合物としては、エチレンジ アミン、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミ ン、ヘキサメチレンジアミン、プロピレンジアミン、ポ リエチレンイミンなどが挙げられる。

【0058】好適なヒドロキシル基を有する化合物とし ては、末端メチロール基を有する化合物、ペンタエリス リトールなどの多価アルコール、ビスフェノール・ポリ フェノール類などを挙げることができる。好ましいカル ボキシル基を有する化合物としては、ピロメリット酸、 トリメリット酸、フタル酸などの芳香族多価カルボン 酸、アジピン酸などの脂肪族多価カルボン酸などが挙げ られる。好適な酸無水物としては、ピロメリット酸無水 物、ベンゾフェノンテトラカルボン酸無水物などが挙げ られる。

【0059】エチレン状不飽和化合物の共重合体の好適 なものとして、アリルメタクリレートの共重合体を挙げ ることができる。例えば、アリルメタクリレート/メタ クリル酸共重合体、アリルメタクリレート/エチルメタ クリレート共重合体、アリルメタクリレート/ブチルメ タクリレート共重合体などを挙げることができる。

【0060】マイクロカプセル化する方法としては、公 知の方法が適用できる。例えばマイクロカプセルの製造 方法としては、米国特許2800457号、同2800 458号にみられるコアセルベーションを利用した方 法、英国特許990443号、米国特許3287154 号、特公昭38-19574号、同42-446号、同 42-711号にみられる界面重合法による方法、米国 特許3418250号、同3660304号にみられる

に見られるイソシアネートポリオール壁材料を用いる方 法、米国特許3914511号に見られるイソシアネー ト壁材料を用いる方法、米国特許4001140号、同 4087376号、同4089802号にみられる尿素 ーホルムアルデヒド系あるいは尿素ホルムアルデヒドー レゾルシノール系壁形成材料を用いる方法、米国特許4 025445号にみられるメラミンーホルムアルデヒド 樹脂、ヒドロキシセルロース等の壁材を用いる方法、特 公昭36-9163号、同51-9079号にみられる モノマー **重合によるin** situ法、英国特許 9 3 0 10 422号米国特許3111407号にみられるスプレー ドライング法、英国特許952807号、同96707 4号にみられる電解分散冷却法などがあるが、これらに 限定されるものではない。

15

【0061】本発明に用いられる好ましいマイクロカプ セル壁は、3次元架橋を有し、溶剤によって膨潤する性 質を有するものである。このような観点から、マイクロ カプセルの壁材は、ポリウレア、ポリウレタン、ポリエ ステル、ポリカーボネート、ポリアミド、およびこれら の混合物が好ましく、特に、ポリウレアおよびポリウレ タンが好ましい。マイクロカプセル壁に熱反応性官能基 を有する化合物を導入しても良い。

【0062】上記のマイクロカプセルの平均粒径は、 0.01~20μmが好ましいが、中でも0.05~ 2. 0μ mがさらに好ましく、0. $10\sim1$. 0μ mが 特に好ましい。この範囲内で良好な解像度と経時安定性 が得られる。このようなマイクロカプセルは、カプセル 同志が熱により合体してもよいし、合体しなくとも良 い。要は、マイクロカプセル内包物のうち、塗布時にカ プセル表面あるいはマイクロカプセル外に滲み出したも 30 の、あるいは、マイクロカプセル壁に浸入したものが、 熱により化学反応を起こせば良い。添加された親水性樹 脂、あるいは、添加された低分子化合物と反応してもよ い。また2種類以上のマイクロカプセルに、それぞれ異 なる官能基で互いに熱反応するような官能基をもたせる ことによって、マイクロカプセル同士を反応させてもよ い。従って、熱によってマイクロカプセル同志が、熱で 溶融合体することは画像形成上好ましいことであるが、 必須ではない。

【0063】マイクロカプセルの感熱層への添加量は、 固形分換算で、好ましくは10~60重量%、さらに好 ましくは15~40重量%である。この範囲内で、良好 な機上現像性と同時に、良好な感度および耐刷性が得ら れる

【0064】マイクロカプセルを感熱層に添加する場 合、内包物が溶解し、かつ壁材が膨潤する溶剤をマイク ロカプセル分散媒中に添加することができる。このよう な溶剤によって、内包された熱反応性官能基を有する化 合物の、マイクロカプセル外への拡散が促進される。こ のような溶剤としては、マイクロカプセル分散媒、マイ 50 酸コポリマー類、スチレンーマレイン酸コポリマー類、

クロカプセル壁の材質、壁厚および内包物に依存する が、多くの市販されている溶剤から容易に選択すること ができる。例えば架橋ポリウレア、ポリウレタン壁から なる水分散性マイクロカプセルの場合、アルコール類、 エーテル類、アセタール類、エステル類、ケトン類、多 価アルコール類、アミド類、アミン類、脂肪酸類などが 好ましい。

【0065】具体的化合物としては、メタノール、エタ ノール、第3ブタノール、nープロパノール、テトラヒ ドロフラン、乳酸メチル、乳酸エチル、メチルエチルケ トン、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチ レングリコールジエチルエーテル、エチレングリコール モノメチルエーテル、yーブチルラクトン、N, Nージ メチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミドな どがあるが、これらに限られない。またこれらの溶剤を 2種以上用いても良い。

【0066】マイクロカプセル分散液には溶解しない が、前記溶剤を混合すれば溶解する溶剤も用いることが できる。添加量は、素材の組み合わせにより決まるもの であるが、適性値より少ない場合は、画像形成が不十分 となり、多い場合は分散液の安定性が劣化する。通常、 塗布液の5~95重量%が有効であり好ましい範囲は、 10~90重量%、より好ましい範囲は15~85重量 %である。

【0067】本発明の感熱層には、このように熱反応性 基を有する微粒子ポリマーあるいはマイクロカプセルを 用いるので、必要に応じてこれらの反応を開始あるいは 促進する化合物を添加してもよい。反応を開始あるいは 促進する化合物としては、熱によりラジカルあるいはカ チオンを発生するような化合物を挙げることができ、例 えば、ロフィンダイマー、トリハロメチル化合物、過酸 化物、アゾ化合物、ジアゾニウム塩あるいはジフェニル ヨードニウム塩などを含んだオニウム塩、アシルホスフ ィン、イミドスルホナートなどが挙げられる。これらの 化合物は、感熱層固形分の1~20重量%の範囲で添加 することができる。好ましくは3~10重量%の範囲で ある。この範囲内で、機上現像性を損なわず、良好な反 応開始あるいは促進効果が得られる。

【0068】本発明の感熱層には親水性樹脂を添加して も良い。親水性樹脂を添加することにより機上現像性が 良好となるばかりか、感熱層自体の皮膜強度も向上す る。親水性樹脂としては、例えばヒドロキシル、カルボ キシル、ヒドロキシエチル、ヒドロキシプロピル、アミ ノ、アミノエチル、アミノプロピル、カルボキシメチル などの親水基を有するものが好ましい。

【0069】親水性樹脂の具体的として、アラビアゴ ム、カゼイン、ゼラチン、澱粉誘導体、カルボキシメチ ルセルロースおよびそのナトリウム塩、セルロースアセ テート、アルギン酸ナトリウム、酢酸ビニルーマレイン ポリアクリル酸類およびそれらの塩、ポリメタクリル酸 類およびそれらの塩、ヒドロキシエチルメタクリレート のホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキシエチルア クリレートのホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキ シプロピルメタクリレートのホモポリマーおよびコポリ マー、ヒドロキシプロピルアクリレートのホモポリマー およびコポリマー、ヒドロキシブチルメタクリレートの ホモポリマーおよびコポリマー、ヒドロキシブチルアク リレートのホモポリマーおよびコポリマー、ポリエチレ ングリコール類、ヒドロキシプロピレンポリマー類、ポ 10 リビニルアルコール類、ならびに加水分解度が少なくと も60重量%、好ましくは少なくとも80重量%の加水 分解ポリビニルアセテート、ポリビニルホルマール、ポ リビニルブチラール、ポリビニルピロリドン、アクリル アミドのホモポリマーおよびコポリマー、メタクリルア ミドのホモポリマーおよびポリマー、Nーメチロールア クリルアミドのホモポリマーおよびコポリマー等を挙げ ることができる。

17

【0070】又、上記親水性樹脂を架橋して用いてもよ く、架橋剤としては、グリオキザール、メラミンホルム 20 アルデヒド樹脂、尿素ホルムアルデヒド樹脂などのアル デヒド類、Nーメチロール尿素やNーメチロールメラミ ン、メチロール化ポリアミド樹脂などのメチロール化合 物、ジビニルスルホンやビス(β-ヒドロキシエチルス ルホン酸)などの活性ビニル化合物、エピクロルヒドリ ンやポリエチレングリトールジグリシジルエーテル、ポ リアミド、ポリアミン、エピクロロヒドリン付加物、ポ リアミドエピクロロヒドリン樹脂などのエポキシ化合 物、モノクロル酢酸エステルやチオグリコール酸エステ ルなどのエステル化合物、ポリアクリル酸やメチルビニ 30 ルエーテル/マレイン酸共重合物などのポリカルボン酸 類、ホウ酸、チタニルスルフェート、Cu、A1、S n、V、Cr塩などの無機系架橋剤、変性ポリアミドポ リイミド樹脂などが挙げられる。その他、塩化アンモニ ウム、シランカプリング剤、チタネートカップリング剤 等の架橋触媒を併用できる。

【0071】本発明の感熱層にはゾルゲル変換によって形成される無機親水性結着樹脂を含有させることができる。好適なゾルゲル変換系結着樹脂は、多価元素から出ている結合基が酸素原子を介して網目状構造を形成し、40同時に多価金属は未結合の水酸基やアルコキシ基も有していてこれらが混在した樹脂状構造となっている高分子体であって、アルコキシ基や水酸基が多い段階ではゾル状態であり、エーテル結合化が進行するに伴って網目状の樹脂構造が強固となる。ゾルゲル変換を行う水酸基やアルコキシ基を有する化合物の多価結合元素は、アルミニウム、珪素、チタン及びジルコニウムなどであり、これらはいずれも本発明に用いることができる。中でも、より好ましいのは珪素を用いたゾルゲル変換系であり、特に好ましのはゾルゲル変換が可能な、少なくとも一つ50

のシラノール基を有するシラン化合物を含んだ系である。以下に、珪素を用いたゾルゲル変換系について説明するが、アルミニウム、チタン、ジルコニウムを用いたゾルゲル変換系は、下記説明の珪素をそれぞれの元素に置き換えて実施することができる。

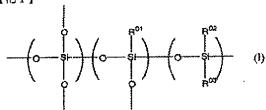
【0072】ゾルゲル変換系結着樹脂は、好ましくはシロキサン結合及びシラノール基を有する樹脂であり、本発明の感熱層には、少なくとも一つのシラノール基を有する化合物を含んだゾル系である塗布液を用い、塗布乾燥過程でシラノール基の縮合が進んでゲル化し、シロキサン骨格の構造が形成されるプロセスによって含有させられる。

【0073】又、ゾルゲル変換系結着樹脂を含む感熱層は、膜強度、膜の柔軟性などの物理的性能の向上や塗布性の改良などを目的として、前記親水性樹脂や架橋剤と併用することも可能である。

【0074】ゲル構造を形成するシロキサン樹脂は、下記一般式(I)で、又少なくとも一つのシラノール基を有するシラン化合物は、下記一般式(II)で示される。又、感熱層に添加される物質系は、必ずしも一般式(I)のシラン化合物単独である必要はなく、一般には、シラン化合物が部分縮合したオリゴマーもしくは一般式(II)のシラン化合物とオリゴマーの混合物あってもよい。

[0075]

【化1】



【0076】一般式 (I) のシロキサン樹脂は、一般式 (II) で示されるシラン化合物の少なくとも1 種を含有する分散液からゾルーゲル変換によって形成される。ここで、一般式 (I) の $R^{\mathfrak{u}}$ ~ $R^{\mathfrak{w}}$ の少なくとも一つは水酸基を表し、他は一般式 (II) 中の記号 $R^{\mathfrak{d}}$ 及びYから選ばれる有機残基を表す。

40 【0077】一般式 (II)

(R°), Si (Y)

【0078】ここで、 R° は水酸基、炭化水素基又はヘテロ環基を表す。Yは水素原子、ハロゲン原子、 $-OR^{\circ}$ 、 $-OCOR^{\circ}$ 、又は $-N(R^{\circ})(R^{\circ})$ を表す。 R° 、 R° は、それぞれ炭化水素基を表し、 R° 、 R° は同じでも異なっていてもよく、炭化水素基又は水素原子を表す。nは0、1、2又は3を表す。

【0079】R°の炭化水素基又はヘテロ環基とは、例 えば炭素数1~12の置換されてもよい直鎖状もしくは 分岐状のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プ ロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ドデシル基等; これらの基に置換される基としては、ハロゲン原子(塩素原子、フッ素原子、臭素原子)、ヒドロキシル基、チオール基、カルボキシル基、スルホ基、シアノ基、エポキシ基、一〇R'基(R'は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘキセニル基、オクテニル基、2ーヒドロキシエチル基、3ークロロプロピル基、2ーシアノエチル基、10ジメチルアミノエチル基、2ーブロモエチル基、2ー(2ーメトキシエチル)オキシエチル基、2ーメトキシカルボニルエチル基、3ーカルボキシプロピル基、ベンジル基等を示す)、

【0080】-OCOR''基(R''は、前記R'と同一の内容を表す)、-COOR''基、-COR''基(R''')(R''')基(R'''は、水素原子又は前記R'と同一内容を表し、それぞれ同一でも異なってもよい)、-NHCONHR''基、-NHCOOR''基、-Si

NHCONHR''基、-NHCOOR''基、-Si (R'') ₃ 基、-CONHR'' 基等が挙げられる。これ らの置換基はアルキル基中に複数置換されてもよい。炭 素数2~12の置換されてもよい直鎖状又は分岐状のア ルケニル基(例えば、ビニル基、プロペニル基、プテニ ル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、オクテニル基、デ セニル基、ドデセニル基等;これらの基に置換される基 としては、前記アルキル基に置換される基と同一内容の ものが挙げられる)、炭素数7~14の置換されてもよ いアラルキル基(例えば、ベンジル基、フェネチル基、 3-フェニルプロピル基、ナフチルメチル基、2-ナフ チルエチル基等;これらに置換される基としては、前記 30 アルキル基に置換される基と同一内容のものが挙げら れ、又複数個置換されてもよい)、炭素数5~10の置 換されてもよい脂環式基(例えば、シクロペンチル基、 シクロヘキシル基、2-シクロヘキシルエチル基、ノル ボニル基、アダマンチル基等、これらに置換される基と しては、前記アルキル基に置換される基と同一内容のも のが挙げられ、又複数個置換されてもよい)、炭素数6 ~12の置換されてもよいアリール基(例えば、フェニ ル基、ナフチル基で、置換基としては、前記アルキル基 に置換される基と同一内容のものが挙げられ、又複数個 置換されてもよい)、又は、窒素原子、酸素原子、イオ ウ原子から選ばれる少なくとも1種の原子を含有する縮 環してもよいヘテロ環基(例えば、ピラン環、フラン 環、チオフェン環、モルホリン環、ピロール環、チアゾ ール環、オキサゾール環、ピリジン環、ピペリジン環、 ピロリドン環、ベンゾチアゾール環、ベンゾオキサゾー ル環、キノリン環、テトラヒドロフラン環等で、置換基 を含有してもよい。置換基としては、前記アルキル基に 置換される基と同一内容のものが挙げられ、又複数個置 換されてもよい)、を表す。

【0081】一般式 (II) のYの-OR 基、-OCO R^2 基又は-N (R^3) (R^4) 基の置換基としては、例 えば以下の置換基を表す。-OR'基において, R'は炭 素数1~10の置換されてもよい脂肪族基(例えば、メ チル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘプチル 基、ヘキシル基、ペンチル基、オクチル基、ノニル基、 デシル基、プロペニル基、ブテニル基、ヘプテニル基、 ヘキセニル基、オクテニル基、デセニル基、2-ヒドロ キシエチル基、2-ヒドロキシプロピル基、2-メトキ シエチル基、2-(2-メトキシエチル) オキシエチル 基、2-(N、N-ジメチルアミノ) エチル基、2-メ トキシプロピル基、2-シアノエチル基、3-メチルオ キシプロピル基、2-クロロエチル基、シクロヘキシル 基、シクロペンチル基、シクロオクチル基、クロロシク ロヘキシル基、メトキシシクロヘキシル基、ベンジル 基、フェネチル基、ジメトキシベンジル基、メチルベン ジル基、ブロモベンジル基等が挙げられる)を表す。

【0082】 $-OCOR^2$ 基において R^2 は R^2 と同一の内容の脂肪族基又は炭素数 $6\sim12$ の置換されてもよい芳香族基(芳香族基としては、前記Rのアリール基で例示したと同様のものが挙げられる)を表す。又-N(R^3)(R^4)基において、 R^3 、 R^4 は、互いに同じでも異なってもよく、それぞれ水素原子又は炭素数 $1\sim10$ の置換されてもよい脂肪族基(例えば、前記の $-OR^4$ 基の R^4 と同様の内容のものが挙げられる)を表す。より好ましくは、 R^3 と R^4 の炭素数の総和が16 以内である。一般式(II)で示されるシラン化合物の具体例としては、以下のものが挙げられるが、これに限定されるものではない。

【0083】テトラクロルシラン、テトラメトキシシラ ン、テトラエトキシシラン、テトライソプロポキシシラ ン、テトラnープロピルシラン、メチルトリクロルシラ ン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシ ラン、エチルトリクロルシラン、エチルトリメトキシシ ラン、エチルトリエトキシシラン、n-プロピルトリク ロルシラン、n-プロピルトリメトキシシラン、n-へ キシルトリメトキシシラン、nーデシルトリメトキシシ ラン、フェニルトリクロルシラン、フェニルトリメトキ シシラン、ジメトキシジトリエトキシシラン、ジメチル ジクロルシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニ ルジメトキシシラン、フェニルメチルジメトキシシラ ン、トリエトキシヒドロシラン、トリメトキシヒドロシ ラン、ビニルトリクロルシラン、ビニルトリメトキシシ ラン、トリフルオロプロピルトリメトキシシラン、ャー グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、yーグ リシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、ァーグリ シドキシプロピルトリエトキシシラン、ャーメタクリロ キシキシプロピルトリメトキシシラン、ャーアミノプロ ピルメチルジメトキシシラン、ャーアミノプロピルトリ 50 エトキシシラン、γーメルカプトプロピルメチルジメト

キシシラン、γーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、γーメルカプトプロピルトリエトキシシラン、βー(3,4-エポキシシクロヘキシル)エチルトリメトキシシランなどが挙げらる。

【0084】本発明の感熱層には一般式(II)のシラン化合物と共に、Ti、Zn、Sn、Zr、A1等のゾルーゲル変換の際に樹脂に結合して製膜可能な金属化合物を併用することができる。用いられる金属化合物として、例えば、Ti(OR''),、TiCl,、Zn(OR''),、Zn(CH, COCH COCH,),、Sn(OR'),、Sn(CH, COCHCOCH,),、Sn(OCO R''),、SnCl,、Zr(OR''),、Zr(CH, COCHCOCH,),、(NH,), Zr(CO,),、A1(OR''),、A1(CH, COCHCOCH,),等が挙げられる。ここでR''は、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等を表す。

【0085】更に一般式(II)で示される化合物、更に併用する前記金属化合物の加水分解及び重縮合反応を促進するために、酸性触媒又は塩基性触媒を併用することが好ましい。触媒は、酸又は塩基性化合物をそのままか、又は水もしくはアルコールなどの溶媒に溶解させた状態のもの(以下、それぞれ酸性触媒、塩基性触媒という)を用いる。その時の濃度については特に限定しないが、濃度が濃い場合は加水分解、重縮合速度が速くなる傾向がある。ただし、濃度の濃い塩基性触媒を用いると、ゾル溶液中で沈殿物が生成する場合があるため、塩基性触媒の濃度は1N(水溶液での濃度換算)以下が望ましい。

【0086】酸性触媒の具体例としては、塩酸などのハロゲン化水素酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、硫化水素、過塩素酸、過酸化水素、炭酸、蟻酸や酢酸などのカルボン酸、ベンゼンスルホン酸などのスルホン酸が挙げられる。塩基性触媒の具体例としては、アンモニア水などのアンモニア性塩基、エチルアミンやアニリンなどのアミン類などが挙げられるが、これらに限定されない。

【0087】以上述べたゾルーゲル法を用いた感熱層は、本発明に特に好ましい。上記ゾルーゲル法の更に詳細は、作花済夫著「ゾルーゲル法の科学」(株)アグネ承風社刊(1988年)、平島碩著「最新ゾルーゲル法による機能性薄膜作成技術」総合技術センター刊(1992年)等に記載されている。

【0088】 親水性樹脂の感熱層への添加量は、感熱層 固形分の $5\sim70$ 重量%が好ましく、 $5\sim50$ 重量%が さらに好ましい。

【0089】本発明の感熱層には、光を吸収し発熱する 光熱変換剤を含有させることが望ましい。本発明に用い られる光熱変換剤としては700nm以上の光を吸収す る物質が特に好ましく、種々の顔料、染料および金属微 粒子を用いることができる。

【0090】顔料としては、市販の顔料およびカラーインデックス(C.I.)便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、1977年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC

50

出版、1986年刊)、「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)に記載されている赤外吸収性の顔料が利用できる。

22

【0091】顔料の種類としては、黒色顔料、褐色顔料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられる。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系顔料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系の類別、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオキサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロの類料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カーボンブラック等が使用できる。

【0092】これら顔料は、表面処理をせずに用いても よく、表面処理を施して用いてもよい。表面処理の方法 には、親水性樹脂や親油性樹脂を表面コートする方法、 界面活性剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シ リカゾル、アルミナゾル、シランカップリング剤やエポ キシ化合物、イソシアナート化合物等)を顔料表面に結 合させる方法等が考えられる。上記の表面処理方法は、 「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、「印刷インキ技 術」(CMC出版、1984年刊)及び「最新顔料応用技 術」(CMC出版、1986年刊)に記載されている。これ らの顔料中、赤外線を吸収するものが、赤外線を発光す るレーザでの利用に適する点で好ましい。かかる赤外線 を吸収する顔料としてはカーボンブラックが好ましく、 水溶性あるいは親水性の樹脂と分散しやすく、かつ親水 性を損わないように親水性樹脂やシリカゾルで表面がコ ートされたカーボンブラックが特に好ましい。顔料の粒 径は $0.01\mu m \sim 1\mu m$ の範囲にあることが好まし く、0.01 μm~0.5 μmの範囲にあることが更に 好ましい。

【0093】染料としては、市販の染料および文献(例えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年刊、「化学工業」1986年5月号P. 45~51の「近赤外吸収色素」、「90年代機能性色素の開発と市場動向」第2章2.3項(1990年刊)CMC)あるいは特許に記載されている公知の染料が利用できる。具体的には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボニウム染料、キノンイミン染料、ポリメチン染料、シアニン染料などの赤外線吸収染料が好ましい。

【0094】さらに、例えば、特開昭58-125246号、特開昭59-84356号、特開昭60-78787号等に記載されているシアニン染料、特開昭58-173696号、特開昭58-181690号、特開昭58-194595号等に記載されているメチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58-224793号、特開昭59-48187号、特開昭59-739

96号、特開昭60-52940号、特開昭60-63 744号等に記載されているナフトキノン染料、 特開 昭58-112792号等に記載されているスクワリリ ウム染料、英国特許434,875号記載のシアニン染 料や米国特許第4, 756, 993号記載の染料、米国 特許第4,973,572号記載のシアニン染料、特開 平10-268512号記載の染料、特開平11-23 5883号記載のフタロシアニン化合物を挙げることが できる。

【0095】また、染料として米国特許第5,156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3,881,924号記載の置換された アリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号記載のトリメチンチアピリリウム塩、特開 昭58-181051号、同58-220143号、同*

*59-41363号、同59-84248号、同59-84249号、同59-146063号、同59-14 6061号に記載されているピリリウム系化合物、特開 昭59-216146号記載のシアニン染料、米国特許 第4、283、475号に記載のペンタメチンチオピリ リウム塩等や特公平5-13514号、同5-1970 2号公報に開示されているピリリウム化合物、エポリン 社製エポライトIII-178、エポライトIII-130、 エポライトIII-125等も好ましく用いられる。これ らの中で、感熱層の親水性樹脂中などの親水性マトリッ 10 クス中に添加するのに好ましい染料は水溶性染料で、以 下に具体例を示す。

[0096] 【化2】

[化3]

[0097]

【0098】本発明の感熱層の微粒子もしくはマイクロカプセル内包物など親油性物質中に添加する光熱変換剤としては、親油性の染料がより好ましい。具体例として

以下の染料を挙げることができる。

[0099]

【化4】

$$(IR-22) \xrightarrow{CH_3} \xrightarrow{CH_3} \xrightarrow{CH_3} \xrightarrow{CH_3} \xrightarrow{C} \xrightarrow{C}_{2H_4OCH_3} \xrightarrow{O}_{3S} \xrightarrow{CCH_3} \xrightarrow{C}_{CH_3}$$

[0100] 【化5】 (IR-26) M=VO, R=i-C₅H₁₁

$$(\operatorname{IR-27}) \bigoplus_{(C_2H_5)_2 N} \operatorname{N(C_2H_5)_2} \\ \bigoplus_{BF_4} \operatorname{N(C_2H_5)_2} \\ \operatorname{N(C_2H_5)_2} N$$

【0101】本発明の感熱層などには、光熱変換剤とし て金属微粒子を用いることもできる。金属微粒子として は、光熱変換性で光照射によって熱融着する金属微粒子 であればいずれの金属微粒子でもよいが、好ましい微粒 子を構成する金属は、第8族及び第18族から選ばれる 金属単体又は合金の微粒子であり、更に好ましくは、A g、Au、Cu、Pt、Pdの金属単体又は合金の微粒 子である。本発明の金属微粒子は、分散安定剤を含む水 溶液に上記の金属塩又は金属錯塩の水溶液を添加し、更 40 に還元剤を添加して金属コロイドとした後、不要な塩を 除去することによって得られる。本発明に用いることが できる分散安定剤には、クエン酸、シュウ酸などのカル ボン酸及びその塩、ポリビニルピロリドン、ポリビニル アルコール、ゼラチン、アクリル樹脂などのポリマーを 用いることができる。本発明に用いることができる還元 剤としては、FeSO4、SnSO4等の卑金属塩、水素化ホウ素 化合物、ホルマリン、デキストリン、ブドウ糖、ロシェ ル塩、酒石酸、チオ硫酸ナトリウム、次亜リン酸塩等が ある。本発明で用いられる塩類除去の方法としては、限

50 外濾過方やコロイド分散系にメタノール/水、又はエタ

ノール/水を添加して自然沈降又は遠心沈降させて、その上澄み液を除去する方法がある。本発明に用いられる 金属微粒子の平均経は、好ましくは1~500nm、より好ましくは1~100nm、特に好ましくは1~50 nmである。その分散度は多分散でよいが、変動係数が 30%以下の単分散の方が好ましい。

29

【0102】光熱変換剤の感熱層への添加量は、有機系 光熱変換剤は、感熱層全固形分の30重量%まで添加す ることができる。好ましくは5~25重量%であり、特 に好ましくは7~20重量%である。金属微粒子系光熱 10 変換剤の場合は、感熱層全固形分の5重量%以上であ り、好ましくは10重量%以上、特に好ましくは20重 量%以上で用いられる。この範囲内で良好な感度が得ら れる。

【0103】本発明の感熱層には、必要に応じて上記以外に種々の化合物を添加してもよい。例えば、耐刷力を一層向上させるために多官能モノマーを感熱層マトリックス中に添加することができる。この多官能モノマーとしては、マイクロカプセル中に入れられるモノマーとして例示したものを用いることができる。特に好ましいモノマーとしては、トリメチロールプロパントリアクリレートを挙げることができる。

【0104】又本発明の感熱層には、画像形成後、画像 部と非画像部の区別をつきやすくするため、可視光域に 大きな吸収を持つ染料を画像の着色剤として使用するこ とができる。具体的には、オイルイエロー#101、オ イルイエロー#103、オイルピンク#312、オイル グリーンBG、オイルブルーBOS、オイルブルー#6 03、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイ ルブラックT-505(以上オリエント化学工業(株) 製)、ビクトリアピュアブルー、クリスタルバイオレッ ト (CI42555)、メチルバイオレット (CI42 535)、エチルバイオレット、ローダミンB(CI1 45170B)、マラカイトグリーン(CI4200 (CI52015)等、および特 開昭62-293247号に記載されている染料を挙げ ることができる。また、フタロシアニン系顔料、アゾ系 顔料、酸化チタンなどの顔料も好適に用いることができ る。添加量は、感熱層塗布液全固形分に対し、0.01 ~10重量%の割合である。

【0105】又、本発明においては、感熱層塗布液の調製中あるいは保存中においてエチレン性不飽和化合物の不要な熱重合を阻止するために、少量の熱重合防止剤を添加することが望ましい。適当な熱重合防止剤としてはハイドロキノン、p-メトキシフェノール、ジーt-ブチルーp-クレゾール、ピロガロール、t-ブチルカテコール、ベンゾキノン、<math>4, 4' -チオビス(3-メチルー6-t-ブチルフェノール)、2, 2'-メチレンビス(4-メチルー6-t-ブチルフェノール)、N-ニトロソーN-フェニルヒドロキシルアミンアルミニウ 50

ム塩等が挙げられる。熱重合防止剤の添加量は、全組成物の重量に対して約0.01~5重量%が好ましい。また必要に応じて、酸素による重合阻害を防止するためにベヘン酸やベヘン酸アミドのような高級脂肪酸やその誘導体等を添加して、塗布後の乾燥の過程で感熱層の表面に偏在させてもよい。高級脂肪酸やその誘導体の添加量は、感熱層固形分の約0.1~約10重量%が好ましい。

【0106】更に本発明の感熱層には、必要に応じ、塗膜の柔軟性等を付与するために可塑剤を加えることができる。例えば、ポリエチレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフルフリル等が用いられる。

【0107】又、本発明の感熱層には無機微粒子を添加 してもよく、無機微粒子としては、シリカ、アルミナ、 酸化マグネシウム、酸化チタン、炭酸マグネシウム、ア ルギン酸カルシウムなどが好適な例として挙げられ、こ れらは光熱変換性でなくても皮膜の強化や表面粗面化に よる界面接着性の強化などに用いることができる。無機 微粒子の感熱層への含有量は、感熱層全固形分の1.0 ~70重量%が好ましく、より好ましくは5.0~50 重量%である。上記無機微粒子は、シリカ、アルミナ、 酸化マグネシウム、酸化チタン、炭酸マグネシウム、ア ルギン酸カルシウムなどの親水性ゾル状粒子もしくはそ れらの混合物として添加してもよい。親水性ゾル状粒子 は、平均粒径が10~50mmのものが好ましく、より 好ましくは10~50nmである。粒径がこの範囲内 で、ポリマー微粒子や光熱変換剤の金属微粒子とも結着 樹脂内に安定に分散し、感熱層の膜強度を充分に保持 し、印刷汚れを生じにくい親水性に優れた非画像部を形 成できる。このような親水性ゾル状粒子は、コロイダル シリカ分散物などの市販品として容易に入手できる。

【0108】本発明の感熱層は、上記各成分の必要なものを溶剤に溶かして塗布液を調製し、基板上に塗布される。使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、メタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチャーテル、1ーメトキシー2ープロパノール、2ーメトキシエチルアセテート、1ーメトキシー2ープロピルアセテート、ジメトキシエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, Nージメチルアセトアミド、N, Nージメチルルムアミド、テトラメチルウレア、Nーメチルピロリドン、ジメチルスルホキシド、スルホラン、γーブチルラクトン、トルエン、水等を挙げることができ、単独又は混合して使用されるが、これに限定されるものではない。塗布液の固形分濃度は、好ましくは1~50重量%である。

【0109】また塗布、乾燥後に得られる基板上の感熱

層の乾燥塗布量は、用途によって異なるが、一般的に 0.5~5.0g/m²が好ましい。塗布する方法とし ては、種々の方法を用いることができるが、例えば、バ ーコーター塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗 布、ディップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、 ロール塗布等を挙げることができる。

31

【0110】本発明に係る感熱層塗布液には、塗布性を 良化するための界面活性剤、例えば、特開昭62-17 0950号に記載されているようなフッ素系界面活性剤 を添加することができる。好ましい添加量は、感熱層全 固形分中0.01~1重量%、さらに好ましくは0.0 5~0.5重量%である。

【0111】[オーバーコート層]本発明の平版印刷用 原板は、親油性物質による感熱層表面の汚染防止のた め、感熱層上に、必要に応じて水溶性オーバーコート層 を設けることができる。本発明に使用される水溶性オー バーコート層は印刷時容易に除去できるものであり、水 溶性の有機高分子化合物から選ばれた樹脂を含有する。 ここで用いる水溶性の有機高分子化合物としては、塗布 乾燥によってできた被膜がフィルム形成能を有するもの で、具体的には、ポリ酢酸ビニル(但し加水分解率65 %以上のもの)、ポリアクリル酸、そのアルカリ金属塩 もしくはアミン塩、ポリアクリル酸共重合体、そのアル カリ金属塩もしくはアミン塩、ポリメタクリル酸、その アルカリ金属塩もしくはアミン塩、ポリメタクリル酸共 重合体、そのアルカリ金属塩もしくはアミン塩、ポリア クリルアミド、その共重合体、ポリヒドロキシエチルア クリレート、ポリビニルピロリドン、その共重合体、ポ リビニルメチルエーテル、ビニルメチルエーテル/無水 マレイン酸共重合体、ポリー2-アクリルアミドー2-メチルー1ープロパンスルホン酸、そのアルカリ金属塩 もしくはアミン塩、ポリー2-アクリルアミドー2-メ チルー1-プロパンスルホン酸共重合体、そのアルカリ 金属塩もしくはアミン塩、アラビアガム、繊維素誘導体 (例えば、カルボキシメチルセルローズ、カルボキシエ チルセルローズ、メチルセルローズ等)、その変性体 、ホワイトデキストリン、プルラン、酵素分解エーテ ル化デキストリン等を挙げることができる。また、目的 に応じて、これらの樹脂を二種以上混合して用いること もできる。

【0112】また、オーバーコート層には、前記の水溶性光熱変換剤を添加しても良い。さらに、オーバーコート層には塗布の均一性を確保する目的で、水溶液塗布の場合には、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリオキシエチレンドデシルエーテルなどの非イオン系界面活性剤を添加することができる。オーバーコート層の乾燥塗布量は、0.1~2.0g/m²が好ましい。この範囲内で、機上現像性を損なわず、指紋付着汚れなどの親油性物質による感熱層表面の良好な汚染防止ができる。

【0113】〔支持体〕本発明に係わる印刷原板は、支持体に関していろいろの形態で用いることができる。特に好ましいのは、金属板そのものを支持体にしてその表面を陽極酸化した金属板の単一構成の形態である。その場合の金属板の厚みはおよそ0.1~0.6 mm程度、好ましくは0.15~0.4 mm、特に好ましくは0.2~0.3 mmである。

【0114】また、金属に支持体を兼ねさせないで、金 属は、薄板(薄層)にしてそれを強度の面で補強できる 低コストの金属板、あるいは可撓性の大きい(フレキシ ブルな) 金属板の表面に金属板を設けてその表面を陽極 酸化してもよい。強度があって低コストの、あるいは可 撓性の大きい、好ましい金属板は、例えばアルミニウ ム、ステンレス鋼、ニッケル、鋼などの金属板である。 これらの支持体金属板と金属板とは、張り合わせてもよ く、また金属板上に金属を薄層上に真空蒸着してもよい が、前者の方が経済的であり、かつ簡単である。以下、 本明細書の記載においては、当業界の慣例にしたがっ て、支持体が金属の場合には、支持体を基板と記すこと もあるが、金属に関しては支持体と基板は同義である。 【0115】そのほか、化学的に安定であって可撓性も 十分なポリエステル類やセルローズエステルなどのプラ スチック支持体の上に金属薄層を設けることもできる。 また、防水加工紙、ポリエチレン積層紙、含浸紙などの 支持体上に金属層を設けてもよい。

【0116】好ましく使用されるプラスチック及び紙支持体としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン 又はポリスチレンがラミネートされた紙、二酢酸セルロース、三酢酸セルロース、プロピオン酸セルロース、酪酸セルロース、硝酸セルロース、硝酸セルロース、水リエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、ポリビニルアセタール等のプラスチックフィルム、アルミニウムがラミネート又は蒸着された紙、もしくはプラスチックフィルム等が挙げられる。

【0117】上記の中でも好ましい支持体は、ポリエステルフィルム、アルミニウム、又は印刷版上で腐食く、乾飲の安であり、その中でも寸法安定性がよく。好き価であるアルミニウム板は特に好ましい。好きニウム板は、純アルミニウム板は、純アルミニウム板は、純アルミニウム板は、大変を含む合金板であり、ラスを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、ラスを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、ラスを主成分とし、微量の異元素を含む合金板であり、ラスを主成分とし、微量の異元素を含むに変更ない。このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウムに、このように本発明に適用されるアルミニウム、このように本発明に適用されるアルミニウム、このように本発明に適用されるアルミニウム、このように本発明に適用されるアルミニウム、このように本発に対している。

ウム板は、その組成が特定されるものではなく、従来よ り公知公用の素材のアルミニウム板を適宜に利用するこ とができる。

【0118】陽極酸化された基体を支持体に用いる場合は、その金属支持体は公知の方法によって粗面化されていてもよい。粗面化は、機械的な手段、電気化学的な手段又は化学的エッチング手段のいずれでもよく、またそれらを組み合わせて行ってもよい。粗面化によってその上に設けられた陽極酸化された遷移金属皮膜の保水性が向上する場合もある。粗面化された好ましい金属支持体 10はアルミニウム支持体である。

【0119】基板とは別に金属支持体を設ける場合、用いられる支持体の厚みはおよそ0.06~0.6mm程度、好ましくは0.1~0.4mm、特に好ましくは0.1~0.3mmであり、遷移金属の薄層の厚みは、0.001~0.1mm程度、好ましくは0.005~0.05mm、特に好ましくは0.01~0.05mmである。

【0120】〔製版及び印刷〕本発明の平版印刷用原板 は熱により画像形成される。具体的には、熱記録ヘッド 20 等による直接画像様記録、赤外線レーザによる走査露 光、キセノン放電灯などの高照度フラッシュ露光や赤外 線ランプ露光などが用いられるが、波長700~120 0 n mの赤外線を放射する半導体レーザ、YAGレーザ 等の固体高出力赤外線レーザによる露光が好適である。 画像露光された本発明の平版印刷用原板は、それ以上の 処理なしに印刷機に装着し、インキと湿し水を用いて通 常の手順で印刷することができる。また、これらの平版 印刷用原板は、日本特許2938398号に記載されて いるように、印刷機シリンダー上に取りつけた後に、印 刷機に搭載されたレーザーにより露光し、その後に湿し 水又はインクをつけて機上現像することも可能である。 また、これらの平版印刷用原板は、水または適当な水溶 液を現像液とする現像をした後、印刷に用いることもで きる。

[0121]

【実施例】以下、実施例により本発明を詳細に説明する が、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0122】基板(1)の製造例

板厚 $0.2 \, \mathrm{mm}$ の市販のチタン板をグリセロリン酸ナトリウム $0.05 \, \mathrm{mol}$ / L と酢酸ストロンチウム $0.09 \, \mathrm{mol}$ / L の混合液を使用して、温度 $4.0 \, \mathrm{C}$ 、電流密度 $5.4 \, \mathrm{dm}^2$ で $4.9 \, \mathrm{H}$ 直流にて陽極酸化後、水洗、乾燥し基板 [A] を作成した。次に浴温 $2.5 \, \mathrm{C}$ 、硫酸 $1.3 \, \mathrm{xi} \, 1.0 \, \mathrm{g}$ / L、硫酸 $4.0 \, \mathrm{g}$ / L の電解液中で $0.8 \, \mathrm{A}$ / dm^2 の電流密度にて $6.0 \, \mathrm{W}$ 間交流電解を行った。

【0123】基板(2)の製造例

実施例1の基板 [A] を浴温25℃、硫酸チタン40g /L、硫酸40g/Lの電解液中で0.8A/dm²の 電流密度にて60秒間交流電解を行った。

【0124】基板(3)の製造例

基板 [A] を下記構造式 (III) のナフトロシアニン色素2重量部をテトラヒドロフランに溶解した溶液に30 \mathbb{C} 、2分間浸渍した後、自然乾燥した。市販の0.2 mmのアルミニウムを硫酸液100g/Lを使用して温度30 \mathbb{C} 、電流密度30A/dm² で20秒間直流にて陽極酸化後、水洗、乾燥し基板 [B] を作成した。MEK40重量部にチッ化チタン3重量部を分散させた溶液中に基板 [B] を30 \mathbb{C} 、2分間浸漬した後、オーブンで100 \mathbb{C} 、1分間乾燥させた。

[0125]

【化6】

【0126】基板(4)の製造例

市販の $0.2 \,\mathrm{mm}$ のアルミニウムを硫酸液 $100 \,\mathrm{g/L}$ を使用して温度 $30 \,\mathrm{C}$ 、電流密度 $30 \,\mathrm{A/dm}^2$ で20秒間直流にて陽極酸化後、水洗、乾燥し基板 [B] を作成した。 $\mathrm{MEK40}$ 重量部にチッ化チタン3重量部を分散させた溶液中に基板 [B] を $30 \,\mathrm{C}$ 、2分間浸漬した後、オーブンで $100 \,\mathrm{C}$ 、1分間乾燥させた。

【0127】基板(5)の製造例

市販の板厚 $0.2 \, \mathrm{mm}$ のジルコニウム板を硫酸液 $100 \, \mathrm{g}$ / Lを使用して温度 $30 \, \mathrm{C}$ 、電流密度 $5 \, \mathrm{A}$ / dm^2 で90 秒間直流にて陽極酸化後、水洗、乾燥し基板 [C] を作成した。基板 [C] を浴温 $25 \, \mathrm{C}$ 、硫酸第 $1 \, \mathrm{A}$ ズ $10 \, \mathrm{g}$ / L、硫 $40 \, \mathrm{g}$ / L、硫酸コバルト $5 \, \mathrm{g}$ / Lの電解液中で $0.8 \, \mathrm{A}$ / dm^2 の電流密度にて $60 \, \mathrm{秒間交流電解}$ を行った。

【0128】基板(6)の製造例

反応性スパッタリング法で作成した。アルゴン/窒素=50/50の雰囲気で500Aの厚みでチッ化チタンを0、2mmのステンレス基板上に作成してから酸化チタンの微粒子を交流電解で充填した。

【0129】基板(7)の製造例

0. 2 mmのステンレス板に酸化アルミを10μmの厚みに大気プラズマ溶射してから、実施例1と同様に交流 電解した。

【0130】熱反応性宮能基を有する微粒子ポリマー

(1) の合成

アリルメタクリレート7.5g、ブチルメタクリレート 50 7.5g、ポリオキシエチレンノニルフェノール水溶液

(濃度 9. 84×10^{3} moll⁻¹) 200 mlを加え、250 rpmでかき混ぜながら、系内を窒素ガスで置換する。この液を25℃にした後、セリウム(IV)アンモニウム塩水溶液(濃度 0. 984×10^{3} moll⁻¹) 10 ml添加する。この際、硝酸アンモニウム水溶液(濃度 58.8×10^{3} moll⁻¹) を加え、PHを1. $3 \sim 1$. 4に調整する。その後8時間これを攪拌した。このようにして得られた液の固形分濃度は9. 5%であり、平均粒径は 0. $4 \mu m$ であった。

【0131】熱反応性官能基をもたない微粒子ポリマー 10 (2)の合成

上記微粒子ポリマー (1) の合成におけるアリルメタクリレートとブチルメタクリレートの代わりに、スチレン15gを用いて、上記合成例 (1) と同様にして重合した。このようにして得られたポリスチレン微粒子分散液*

* の固形分濃度は 9. 0 重量%であり、平均粒径は 0. 3 μmであった。

36

【0132】マイクロカプセル(1)の調製

油相成分として、キシレンジイソシアネート40g、トリメチロールプロパンジアクリレート10g、アリルメタクリレートとブチルメタクリレートの共重合体(モル比7/3)10g、パイオニンA41C(竹本油脂製)0.1gを酢酸エチル60gに溶解した。水相成分として、PVA205(クラレ製)の4%水溶液を120g作製した。油相成分および水相成分をホモジナイザーを用いて10000rpmで乳化した。その後、水を40g添加し、室温で30分、さらに40 $^{\circ}$ で3時間攪拌した。このようにして得られたマイクロカプセル液の固形分濃度は20%であり、平均粒径は0.5 $^{\circ}$ μmであった。

[0133]

感熱層(1)塗布液

合成した微粒子ポリマー (1) または (2)	固形分換算で5 g
ポリヒドロキシエチルアクリレート	
(重量平均分子量2.5万)	0. 5 g
赤外線吸収染料(IR11)	0.3g
水	100 g

[0134]

感熱層(2)塗布液

合成したマイクロカプセル(1)	固形分換算で5g
トリメチロールプロパントリアクリレート	3 g
赤外線吸収染料(IR-11)	0.3g
水	60 g
1ーメトキシー2ープロパノール	40 g

[0135]

感熱層(3)塗布液

酸化チタン粉末

(和光純薬(株)製、ルチル型、平均粒径 0. 2 μ m)	20 g
コロイダルシリカ(粒径10~20nm)	
2 0 重量%水分散物	60 g
ポリビニルアルコール	
(クラレ(株)製PVA117)5重量%水溶液	70 g
銀コロイド6重量%水溶液 1:	50 g
ゾルゲル変換系結着樹脂調整液	28 g
微粒子ポリマー(1)(固形分9.5重量%) 1:	15 g
*	200

【0136】ここで、金属微粒子光熱変換剤の銀コロイド水溶液及びゾルゲル変換系結着樹脂調整液は、下記のように調整したものである。

【0137】銀コロイド水溶液調整方法クエン酸ナトリウム32重量%水溶液560mlに、攪拌しながら、硫酸第一鉄30重量%水溶液100mlを添加した。均一に混合した後、激しく攪拌しながら、硝酸銀10重量%水溶液100mlを30秒以内に添加終了するように添加した。約10分後に攪拌を停止した。出来上がった銀コロイド中の不要な塩類を除去するために、限外濾過装50

置で水洗(超濾過)を施した。限外濾過装置は米国Amic on社製CH2PRS型を用い、フィルターはSIY30(カットオフ分子量30,000)を用いた。水洗は、電導度が約 50μ S/cmになるまで行った。水洗後、銀濃度が6重量%になるように調整した。銀コロイドの平均粒子サイズは8nmであった。

【0138】ゾルゲル変換系結着樹脂調整液

テトラエトキシシラン15.0g、エタノール30.0g、0.1mol/L硝酸4.5gを混合し、室温で2時間 熟成した。

【0139】実施例1~7および比較例1~7

基板上に、感熱層 (1) の塗布液を用い、バー塗布およ びオーブン乾燥(100℃60秒間)により乾燥塗布量 が0.5g/m゚の感熱層を設けて、平版印刷用原板を作 製した。ここで基板は、実施例1~7に対応して、それ ぞれ基板(1)~(7)を用いた。又、実施例1~7に 用いた基板を、それぞれ製造例の操作のうち光熱変換剤 の埋め込みをしなかった基板に代えた平版印刷用原板 を、比較例1~7とした。

【0140】このようにして得られた平版印刷版を、水 冷式40W赤外線半導体レーザを搭載したクレオ社製ト レンドセッター3244VFSにて、出力9W、外面ド ラム回転数210rpm、版面エネルギー100mJ/ cm^{*}、解像度2400dpiの条件で露光した後、処 理することなく、ハイデルベルグ社製印刷機SOR-M のシリンダーに取付け、湿し水を供給した後、インキを 供給し、さらに紙を供給して印刷を行った。実施例1~ 7の印刷版については、問題なく機上現像ができ、印刷 可能であった。一方、比較例1~7の印刷版は、低感度 のため、上記同一露光エネルギーでは着肉性、耐刷力と も劣り、満足な印刷ができなかった。

【0141】実施例8~11

下記の表1に示した基板と感熱層との組み合わせで、実 施例1~7と同様にして平版印刷用原板を作製した。得 られた平版印刷版を実施例1~7と同様に露光し、印刷 したところ、問題なく機上現像され、良好な印刷物が得 られた。

[0142]

【表 1 】

	基板 感熱層		燃熱層の成分		
実施例8	(1)	(1)	微粒子ポリマー (2)		
実施例 9	(4)	(1)	微粒子ポリマー(2)		
実施例 10	(1)	(2)	マイクロカブセル (1)		
実施例 11	(4)	(2)	マイクロカプセル (1)		

*【0143】実施例12

感熱層(3)の塗布液を、ペイントシェーカーで10分 間分散して調製し、基板(1)上に乾燥塗布量3.0g /m²になるようにバー塗布し、オーブン乾燥(100 ℃、10分間)して平版印刷用原板を作製した。得られ た印刷用原板表面の水滴接触角を測定したところ、拡張 濡れを示し、非常に親水性の高い表面であった。

【0144】得られた印刷用原板をレーザービーム走査 露光装置としてPEARLsetter74 (Presstek社製)を用い て版面エネルギー150m J/cm²、解像度1270 d p i の条件で露光した。その結果、露光部表面に熱融 着した画像領域が形成された。この画像領域表面の水滴 接触角は108度で、疎水性の高い表面に変化したこと を示した。この露光済みの印刷版を処理することなく、 印刷機(RYOBI-3200MCD)に装着した。湿 し水にEU-3 (富士写真フイルム(株)製)の1容量 %水溶液を用い、湿し水で30回転ロールアップ(なら し運転)を行い、次いでGEOS(N)墨インキ(大日 本インキ化学工業(株)製)を供給して印刷を開始し、 10,000枚まで印刷汚れがなく、高品質の印刷物が 得られた。

【0145】実施例13~18

実施例12の基板(1)の代わりに、実施例13では基 板(2)、実施例14では基板(3)、実施例15では 基板(4)、実施例16では基板(5)、実施例16で は基板(5)、実施例17では基板(6)、実施例18 では基板 (7) を用いた以外は実施例12と同様にし て、平版印刷用原板を作製した。得られた印刷用原板を 実施例12と同様に露光、印刷したところ、いずれの印 30 刷用原板からでも、10,000枚まで印刷汚れがな く、高品質の印刷物が得られた。

[0146]

【発明の効果】本発明によれば、デジタル信号に基づい た走査露光による製版が可能であり、露光後、処理を行 うことなく直接印刷機に装着して印刷することができ、 耐刷性および汚れ難さに優れ、しかも、感度の改良され た感熱性平版印刷用原板を提供できる。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 7		識別記号	ΡI			テーマコード(参考)
G03F	7/032	502	G 0 3 F	7/032	502	
	7/033			7/033		
	7/038			7/038		
	7/09	501		7/09	501	

(72) 発明者 堀田 久

静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内

Fターム(参考) 2H025 AA12 AB03 AC08 AD01 AD03

BC51 BD21 BD23 BD24 BD27

CB14 CB16 CB28 CB30 CC20

DA10 DA20 FA10

2H084 AA14 AE05 BB04 CC05

2H114 AA22 AA24 BA01 DA04 DA08

DA15 DA25 DA52 DA73 EA01

EA03 EA04 FA16 GA09 GA32

GA34 GA38